

DLC膜種

	標準DLC	A-DLC	S-DLC	有機シリカ膜
成膜温度 (°C)	200°C以下	100°C以下		
硬度	HV1500-1600	HV600-700	HV700-900	HV800-1100
摩擦係数	0.1-0.2	0.08-0.12	0.05-0.1	0.1-0.15
耐磨耗性	○	×	△	○
離型性	△	△	○	○
水に対する 接触角 (°)	60-70	70-80	80-90	85-95
用途	対磨耗性	絶縁物用	摺動性、離型性	離型性、対磨耗性

DLC成膜装置【3号機】

プラズマCVD方式により低温処理が可能。
基材全方位にプラズマを生成するため、つき回りが良い。

プラズマPVDで金属膜も製作可能。

【膜スペック】

膜厚: 0.01-10um

硬度: Hv600-1600

密着力: 15N以上

【加工可能シリンダー】

全長: 1300mm以内

面長: 1100mm以内

直径: 300mm以内

重量: 50kg以内



DLC成膜装置【4号機】

機能はDLC成膜装置3号機と同等。

【膜スペック】

膜厚: 0.01-10um

硬度: Hv600-1600

密着力: 15N以上

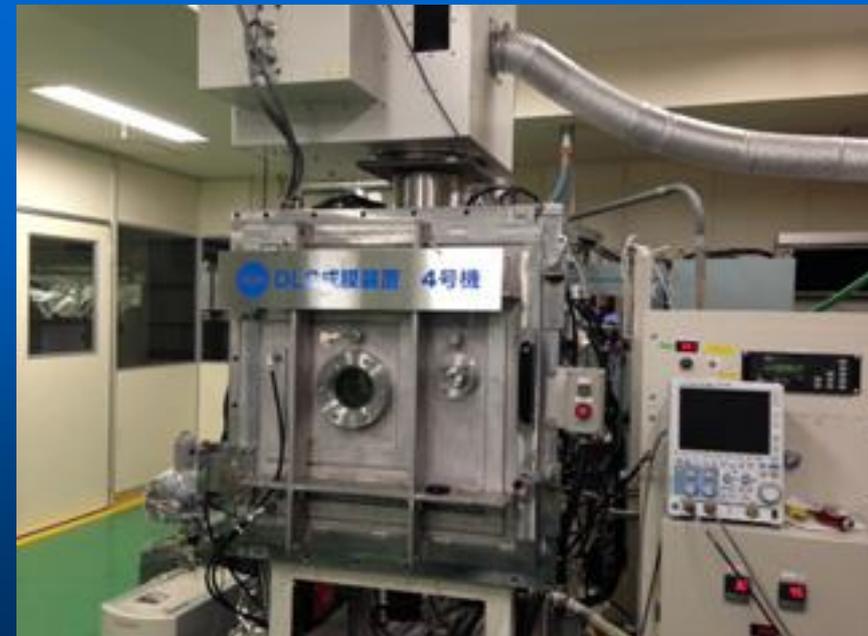
【加工可能シリンダー】

全長: 500mm以内

面長: 300mm以内

直径: 200mm以内

重量: 10kg以内



DLC成膜装置【大型機】

Φ1800mm x 4000mmの真空槽を備えたプラズマCVD成膜機

突起物への成膜追従性も良好

【膜スペック】

膜厚: 0.01-10μm

硬度: Hv600-1600

密着力: 15N以上

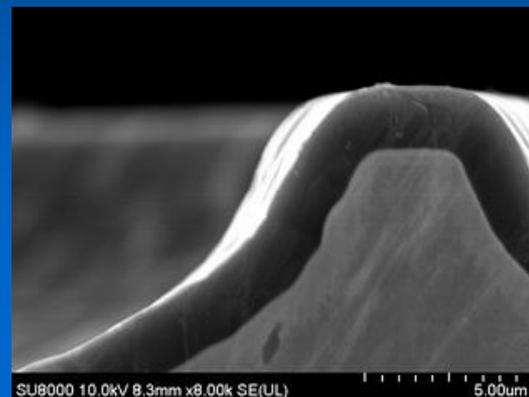
加工可能シリンダー

全長: 3000mm以内

面長: 2500mm以内

直径: 1000mm以内

重量: 2500kg以内



装置毎のスペックまとめ

	DLC3号機	DLC4号機	DLC大型機
基本仕様			
膜厚	0.01~10 μ m		
硬度	HV600-1600		
密着力	15N以上		
加工可能シリンダー			
全長 (mm)	1300	500	3000
面長 (mm)	1100	300	2500
直径 (mm)	300	200	1000
重量 (kg)	50	10	2500
その他			
成膜手法	プラズマCVD スパッタリング	プラズマCVD スパッタリング	プラズマCVD